

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成19年1月18日(2007.1.18)

【公表番号】特表2002-532838(P2002-532838A)

【公表日】平成14年10月2日(2002.10.2)

【出願番号】特願2000-587588(P2000-587588)

【国際特許分類】

H 05 H 1/42 (2006.01)

H 01 J 37/32 (2006.01)

【F I】

H 05 H 1/42

H 01 J 37/32

【手続補正書】

【提出日】平成18年11月10日(2006.11.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】少なくとも1つの高周波源(15)と、少なくとも1つのガス入り口開口(10)および少なくとも1つのビーム出口開口(13)を備えた、電磁放射に対し透過性の中空体(11)、特に管とを有する低温フリー・プラズマビーム(21)を発生する装置であって、高周波プラズマソース(15)が中空体(11)の内部に低温プラズマを発生する形式のものにおいて、作業室(19)が設けられており、該作業室内部に、中空体(11)内で生成した低温プラズマ(12)を低温フリー・プラズマビーム(21)としてビーム出口開口(13, 13')を介して中空体(11)から入射させかつそこで収束させて導くことを特徴とする、低温フリー・プラズマビームを発生する装置。